

高真空蒸着装置 RD-1400



高真空蒸着装置RD-1400は小型蒸着装置の水
晶振動式膜厚計搭載型抵抗加熱蒸着装置です。

研究機構向けに開発された本装置は、抵抗加
熱機構3対(切替式)を装備し、真空状態のまま多
層膜が可能です。

また排気系はターボ分子ポンプを採用しており
ますので、クリーンな排気が可能です。

基板加熱機構としてハロゲンランプを2台搭載し
ておりますので、短時間で350℃まで昇温可能で
す。

基板回転機構も標準搭載した本装置は、膜厚分
布の精度も±10%以内となっております。

高真空蒸着装置RD-1400仕様

- 到達圧力 7.0×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷時
- 排気速度 ×10⁻⁴Pa台迄排気開始後10分以内※常温・無負荷時
- 真空漏洩量 1.0×10⁻¹⁰Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 400mmW×400mmD×700mmH SUS304
- 蒸着機構 抵抗加熱方式3対切替式(ポート)
AC10V0~250A
制御方式:サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム
- 基板形状 φ6インチウエハー×1枚取付可能
- 基板回転 モーター直接駆動方式 0~16rpm[60Hz]
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5kW×2式
常温~350℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:400L/min[60Hz]
ターボ分子ポンプ:480L/sec
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 手動/自動(排気系の立ち上げ/蒸着準備/ベント/排気系の立ち下げ:4種類)
- ユーティリティ電気:AC200V三相7.0KVA
冷却水:6.0L/min以上0.03MPa以上0.1MPa以下25℃以下循環
寸法:1100mmW×700mmD×1800mmH

